

Title (en)
Vapour deposition apparatus.

Title (de)
Vakuumaufdampfeinrichtung.

Title (fr)
Dispositif de revêtement par condensation de vapeur.

Publication
EP 0164132 A2 19851211 (DE)

Application
EP 85107073 A 19850607

Priority
DE 3421538 A 19840608

Abstract (en)
[origin: US4690098A] In a vacuum vapor-deposition system a substrate holder is arranged stationary in the main part of a vapor-deposition chamber. Evaporation apparatuses are arranged on the floor of the vapor-deposition chamber, which is moveably connected to the main part of the vacuum-deposition chamber via a bellows and can swivel about two mutually intersecting axes or be displaced along two mutually intersecting axes with respect to the main part by means of two drive mechanisms. In this way the thermostatisation of the substrate and the production of very uniform layers is facilitated.

Abstract (de)
Bei der vorliegenden Vakuumaufdampfeinrichtung ist die Substrathalterung (36) stationär im Hauptteil der Aufdampfkammer angeordnet. Die Verdampfervorrichtungen (42) sind am Boden (14) der Aufdampfkammer angeordnet, der über einen Balgen (16) beweglich mit dem Hauptteil der Aufdampfkammer verbunden und durch zwei Antriebsvorrichtungen (60) bezüglich des Hauptteiles um zwei sich kreuzende Achsen schwenkbar oder längs zweier sich kreuzender Achsen verschiebbar ist. Hierdurch wird die Thermostatisierung des Substrats und die Herstellung sehr gleichmässiger Schichten erleichtert.

IPC 1-7
C23C 14/24

IPC 8 full level
C30B 23/08 (2006.01); **C23C 14/24** (2006.01); **G02B 5/28** (2006.01); **H01L 21/203** (2006.01)

CPC (source: EP US)
C23C 14/24 (2013.01 - EP US)

Cited by
EP0228910A1

Designated contracting state (EPC)
DE FR GB

DOCDB simple family (publication)
EP 0164132 A2 19851211; **EP 0164132 A3 19880824**; DE 3421538 A1 19851212; JP S62100499 A 19870509; US 4690098 A 19870901

DOCDB simple family (application)
EP 85107073 A 19850607; DE 3421538 A 19840608; JP 23779485 A 19851025; US 79270085 A 19851029